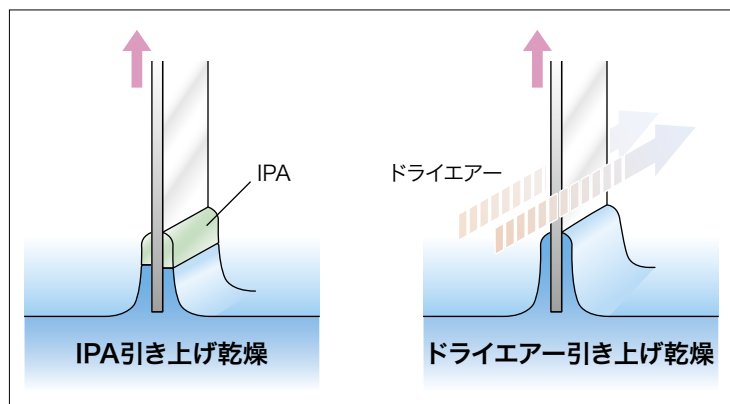


Doc. No.: NR081120

2008年11月20日

## 世界初、VOC 排出量ゼロの300ミリ半導体ウエハー洗浄装置を開発 ～環境負荷とランニングコストを大幅に抑制するドライエアードライ技術を搭載～

大日本スクリーン製造株式会社はこのほど、300ミリウエハーの半導体デバイス量産ラインにおいて世界初<sup>※1</sup>となる、IPA（イソプロピルアルコール）を使用しない新たな乾燥技術を開発。同技術を採用した「ドライエアドライモジュール（DAD）」を搭載するバッチ式<sup>※2</sup>洗浄装置「FC-3100」を、2008年12月から販売します。



☆ この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、下記URLよりダウンロードできます。  
([www.screen.co.jp/press/nr-photo/](http://www.screen.co.jp/press/nr-photo/))

近年、半導体業界では、デバイス回路の微細化がますます進行する中、処理プロセスの高度化や生産量の増加に伴い、各製造工程で使用される化学物質の排出量も増大しています。ウエハー洗浄工程で使用されるIPAは、大気汚染防止法によって規制されているVOC（揮発性有機化合物）の一種に指定されており、環境負荷の低減に取り組む半導体デバイスメーカーにとって、IPA排出量の削減が大きな課題の一つとなっています。

今回「FC-3100」に搭載するモジュール「DAD」は、極めて露点の低いドライエアードライ（乾燥空気）をウエハーに吹き付け、洗浄後の水分を瞬間的に除去。IPAを一切使用しないため、VOC排出量ゼロを実現します。また、従来のIPAによる乾燥と同等の性能を実現しながらも、処理時間を約2分の1に短縮し、ランニングコストを最大で8分の1にまで低減<sup>※3</sup>できます。そのほか、これまで装置を設置する際に必要だった防火設備や工場へのIPA回収処理施設の設置が不要になるなど、環境に優しく、安全性にも優れた装置となっています。

当社は今後も、環境に配慮した製品開発を一層強化し、市場ニーズに応えることで世界トップシェアを誇る300ミリ対応ウエハー洗浄装置のさらなるシェア拡大を目指します。そして、半導体洗浄装置におけるグローバルスタンダードとしての地位をより強固なものにするとともに、業界の発展に貢献していきます。

※1 2008年11月現在

※2 バッチ式  
複数のウエハーを一度に処理できる方式。

※3 当社比

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目